# AI 딥러닝을 활용한 RGBA 색 공간으로 반도체 칩 분류 및 칩 이상 검출에 관한 연구

조주용<sup>\*</sup> 한국폴리텍대학 인천캠퍼스 산학협력중점교수

## Research on Semiconductor Chip Classification and Defect Detection Using AI Deep Learning with RGBA Color Space

Ju-Yong Cho\*

Professor of Industry-Academia Cooperation, Incheon Campus, Korea Polytechnic University

요 약 최근 정부의 AI 및 반도체 인재 양성 정책에 부응하여, 본 연구는 AI 딥러닝 기술을 활용하여 RGBA 색 공간에서 반도체 칩을 효과적으로 분류하고 결함을 검출하는 방법을 제안하고 있다. 반도체 칩의 품질 보증과 결함 검출은 전자 기기의 신뢰성과 성능을 보장하는 데 필수적이다. 그러나 전통적인 검사 방법은 주로 시각적 검사 와 기계 측정, 전기적 테스트를 포함하며, 이러한 방법은 시간이 많이 소요 되고, 최첨단 장비의 비용이 많이 들고 검사로 인해 많은 생산 환경에 비효율적 이라는 것이다. 이를 해결하기 위해 딥러닝 기반의 이미지 분석 기법이 자동화된 검사 시스템에서 주목받고 있다. 이번 실험을 통해 RGBA 색 공간을 활용한 딥러닝 모델이 반도체 칩의 결함 검출 및 분류에서 뛰어난 성능을 발휘함을 확인하였다. 특히 알파 채널을 포함한 RGBA 색 공간이 기존 RGB 색 공간 모델보다 결함 검출에 있어 더 정확하고 정밀한 결과를 적은 학습으로도 제공한다. 이번 실험 결과는 RGBA 색 공간이 딥러닝 기반 결함 검출시스템에서 중요한 역할을 할 수 있음을 시사하며, 향후 다양한 데이터셋과 조건에서의 추가 실험을 통해 이 방법의활용 범위를 넓힐 수 있을 것이다. 이러한 모델은 반도체 제조 공정의 자동화와 품질 향상에 기여할 가능성이 크다.본 연구는 RGBA 색 공간의 장점을 활용하여 반도체 칩 검사 과정의 정확성과 효율성을 향상시키고자 한다.

주제어: AI, 딥러닝, RGBA 색 공간, 반도체 칩 분류, 이상 검출

Abstract In response to the recent government's AI and semiconductor talent training policy, this study proposes a method of effectively classifying semiconductor chips and detecting defects in RGBA color space using AI deep learning technology. Quality assurance and defect detection of semiconductor chips are essential to ensure the reliability and performance of electronic devices. However, traditional inspection methods mainly include visual inspection, mechanical measurement, and electrical testing, which are time-consuming, expensive for state-of-the-art equipment, and inefficient for many production environments due to inspection. To solve this problem, image analysis techniques based on deep learning are attracting attention in automated inspection systems. Through this experiment, it was confirmed that the deep learning model using RGBA color space shows excellent performance in defect detection and classification of semiconductor chips. In particular, RGBA color space including alpha channel provides more accurate and precise results for defect detection than conventional RGB color space models with less learning. The results of this experiment suggest that the RGBA color space can play an important role in the deep learning-based defect detection system, and further experiments in various datasets and conditions will expand the scope of the method's use in the future. Such a model is highly likely to contribute to the automation and quality improvement of the semiconductor manufacturing process. This study aims to improve the accuracy and efficiency of the semiconductor chip inspection process by utilizing the advantages of RGBA color space.

Key Words: AI; Deep Learning; RGBA Color Space; Semiconductor Chip Classification; Defect Detection

\*교신저자 : 조주용(jaryonge@hanmail.net)

접수일: 2024년 10월 07일 수정일: 2024년 10월 30일 심사완료일: 2024년 11월 08일

## 1. 서론

최근 정부는 AI 및 반도체 인재 양성에 대한 정책을 강화하고 있으며, 이는 전자 산업의 혁신과 경쟁력을 높 이기 위한 노력의 일환이다. 반도체 칩은 현대 전자 기기 의 핵심 구성 요소로서, 그 품질과 신뢰성은 기기의 전반 적인 성능에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 반도체 칩 의 품질 보증과 결함 검출은 매우 중요하다.

전통적인 반도체 칩 검사 방법은 주로 시각적 검사와 기계적 측정을 포함하며, 이들 방법은 시간과 비용이 많 이 소모되고 검사 결과의 일관성에 한계가 있다. 특히, 인간의 시각에 의존하는 검사 방법은 미세한 결함을 놓 칠 가능성이 있으며, 대규모 생산 환경에서는 실용적이 지 않을 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 자동화 된 검사 시스템의 도입이 필수적이다.

딥러닝 기반의 이미지 분석 기법은 이러한 요구를 충 족시킬 수 있는 강력한 도구로 부각되고 있으며 특히, 딥 러닝 모델은 대량의 데이터에서 패턴을 학습하고, 정밀 한 결함 검출과 분류를 가능하게 한다[1]. 최근의 연구들 에서는 주로 RGB 색 공간을 사용하여 이미지를 분석하 였으나, RGBA 색 공간은 추가적인 알파 채널을 통해 이 미지의 투명도 정보를 제공함으로써, 반도체 칩의 세밀 한 결함을 보다 정확하게 분석할 수 있는 잠재력을 가지 고 있다[2].

RGBA 색 공간의 장점을 활용하여 반도체 칩의 이미 지를 보다 정밀하게 분석하고, 딥러닝 기술을 통해 효과 적으로 분류 및 결함 검출을 수행할 수 있는 방법을 제안 하며 기존 검사 방법이 가진 시간적, 비용적 제약 극복과 검사 과정의 정확성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. AI 및 딥러닝 기술의 실제 산업 적용 가능성을 탐구하며, 향후 반도체 산업의 품질 관리 및 자 동화된 검사 시스템의 발전에 기여하고자 한다[3].

#### 2. 이론적 배경

이론적 배경에서는 본 연구의 핵심 개념인 AI 딥러닝, RGBA 색 공간, 그리고 반도체 칩의 결함 검출과 분류의 기초 이론을 설명하고자 한다.

#### 2.1 AI 딥러닝

딥러닝은 인공지능(AI)의 한 분야로, 다층 신경망을 사용하여 데이터에서 복잡한 패턴을 학습하고 예측하는 기술이다. 딥러닝 모델은 입력 데이터를 여러 층의 뉴런 을 통해 처리하여 특징을 추출하고, 이 특징을 바탕으로 최종 결과를 도출한다. 이 과정에서 각 층은 이전 층에서 추출된 정보를 기반으로 더욱 추상적인 특징을 학습한다. 주요 알고리즘으로는 Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), Generative Adversarial Networks (GANs) 등이 있 고, 특히 CNN은 이미지 처리에서 뛰어난 성능을 보이 며, 이미지 분류, 객체 검출, 세분화 등 다양한 응용 분야 에서 사용된다[4].

#### 2.2 RGBA 색 공간

RGBA 색 공간은 이미지의 색상 정보를 표현하는 RGB 색 공간에 알파 채널을 추가하여 이미지의 투명도 를 나타내는 색 공간이다. RGB 색 공간은 Red, Green, Blue의 세 가지 색상 채널을 사용하여 색을 표현하는 반 면, RGBA 색 공간은 여기에 Alpha 채널을 추가하여 투 명도를 포함키고 이 추가적인 채널은 이미지의 배경과의 상호작용, 또는 이미지의 깊이 정보를 제공하는 데 유용 하며, 특히 세밀한 분석이 필요한 상황에서 유리하다[5]. RGBA 색 공간을 사용하면 이미지의 세부적인 변화를 더 정확하게 캡처할 수 있어, 결함 검출과 같은 작업에서 보다 정밀한 결과를 도출할 수 있다[6].

#### 2.3 반도체 칩의 결함 검출과 분류

반도체 칩은 전자 기기의 핵심 부품으로, 그 품질과 신뢰성은 기기의 전반적인 성능에 큰 영향을 미친다. 반 도체 칩의 결함 검출과 분류는 제조 과정에서 중요한 품 질 보증 단계로, 다양한 결함 유형을 정확하게 식별하고 분류하는 것이 필요하다. 전통적인 검사 방법은 주로 시 각적 검사 와 기계 측정, 전기적 테스트를 포함하며, 이 러한 방법은 시간이 많이 소요 되고, 검사원의 관측도로 인해 일관성이 없고, 최첨단 장비의 비용이 많이 들고 검 사로 인해 많은 생산 환경에 비효율적 이라는 것이다. 최 근에는 딥러닝 기반의 이미지 분석 기법이 결함 검출과 분류의 자동화와 정밀도를 크게 향상시키고 있다. 딥러 닝 모델은 대량의 이미지 데이터를 학습하여 복잡한 패 턴과 결함을 인식하고, 높은 정확도로 결함을 검출할 수 있다. 이러한 배경을 바탕으로, 본 연구는 RGBA 색 공 간을 활용하여 반도체 칩의 결함을 보다 정밀하게 분석 하고, 딥러닝 기술을 통해 검출과 분류의 효율성을 높이 는 방법을 제안하고자 한다[7]. RGBA 색 공간의 추가적 인 알파 채널 정보를 통해 더 세밀한 결함 분석이 가능하 며, 딥러닝의 강력한 패턴 인식 능력을 활용하여 검사의 정확성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

### 3. 실험

#### 3.1 실험 목적

본 실험의 목적은 RGBA 색 공간을 활용하여 반도체 칩을 효과적으로 분류하고 결함을 검출하는 AI 딥러닝 모델을 개발하고 평가하는 것이다. 이를 통해, 기존의 RGB 색 공간 기반 모델과 비교하여 RGBA 색 공간의 효과를 분석하고, 검사 과정의 정확성과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

## 3.2 데이터 수집 및 전처리









Good Product 1 Faulty Product 1 Faulty Product 2 Faulty Product 3

[Fig. 1] Photographs of one good and three faulty DC-DC converters

#### 3.2.1 데이터셋

DC-DC Converter 이미지를 양품1개와 불량3개의 [Fig. 1]의 반도체 데이터를 기반으로 칩 이미지 데이터는 칩의 정상 및 결함 이미지를 포함하며, 해상도는 150x150x4 픽셀, 컬러 모드는 RGB 색 공간으로 수집되었다.

#### 3.2.2 데이터 전처리









Good Product 1 Faulty Product 1 Faulty Product 2 Faulty Product 3

#### [Fig. 2] Canny Edge Images

수집된 이미지는 이미지 처리 과정에서는 원본 이미지에서 Canny 엣지 감지 알고리즘을 적용하여 엣지를 추출한 후 [Fig. 2]처럼 나타나며, 형태학적 팽창 연산을 통해 엣지를 강조한다[8].









Good Product 1 Faulty Product 1 Faulty Product 2 Faulty Product 3

#### [Fig. 3] Delation Images

[Fig. 3]의 이미지를 얻을 수 있다. 이후, 이진화된 이미지를 사용하여 원본 컬러 이미지를 채널 차원에서 결합하여 4채널 최종 이미지를 생성한 데이터를 [Fig. 4]에서 보여주고 있다.









Good Product 1 Faulty Product 1 Faulty Product 2 Faulty Product 3

[Fig. 4] RGB + A(Delation) Images



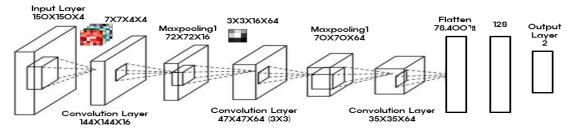
[Fig. 5] Augmented data

결함이 포함된 영역을 보다 정확히 식별할 수 있게 하기 위하여 회전, 자르기, 이동 등의 이미지 증강을 통해데이터양을 증가시키고 원본 DC-DC Converter 이미지에서 RGBA (RGB + Delation) 이미지를 추출하였다. 이 과정으로 데이터를 [Fig. 5]처럼 원본 이미지 DC-DC converter 양품1개와 불량3개를 이용하여 데이터를 증가하였다.

#### 3.3 딥러닝 모델 개발

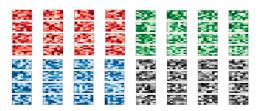
#### 3.3.1 모델 아키텍처

제안된 모델 [Fig. 6]은 딥러닝 분류기 전체 구조를 보여주고 있으며 TensorFlow의 Keras 라이브러리를 사용하여 Sequential API로 구성되었다. 모델의 입력 층은 150x150 크기와 4채널(RGB + 알파)의 이미지를 받아서 첫 번째 컨볼루션 층은 16개의 7x7 필터와 ReLU 활성화 함수를 사용하며, 첫 번째 맥스 풀링 층에서 2x2 풀 크기를 사용하는 것은 공간적 차원을 절반으로 축소



[Fig. 6] Overall structure of the deep learning classifier

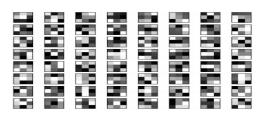
하여 계산량을 줄이고 학습 속도를 높이는 동시에 중요한 국소적 특징을 보존하기 위함이다. 또한, 2x2 풀 크기는 CNN 설계에서 널리 검증된 표준적 관행으로, 모델구조의 일관성을 유지하고 과적합을 방지하며 학습 안정성을 향상시키는 데 효과적이다. 두 번째 컨볼루션 층은 64개의 3x3 필터와 ReLU 활성화 함수를 사용하여 입력된 특징 맵에서 더 복잡하고 추상적인 특징을 추출한다.이 층은 첫 번째 컨볼루션 층에서 학습된 국소적인 특징을 기반으로, 보다 심층적인 공간적 패턴과 경계선을 감지하는 역할을 수행한다. 이후 적용되는 맥스 풀링 층은 공간적 차원을 축소하여 특징 맵의 크기를 감소시키면서중요한 특징만을 유지하도록 돕는다. 이 단계는 계산 비용을 줄이고, 모델의 일반화 성능을 높이며, 과적합을 방지하는 데 기여한다. [Fig. 7]은 4채널(RGBA) 필터를 표시하고 있다.



[Fig. 7] 4-Channel (RGBA) filter.

세 번째 컨볼루션 층은 64개의 3x3 필터와 ReLU 활성화 함수를 사용하여, 이전 층에서 추출된 고수준 특징들을 더 정교하게 분석하고 세부적인 패턴을 학습하는 역할을 한다. 이 층은 모델이 보다 구체적이고 복잡한 특성을 인식할 수 있도록 지원하며, 객체의 세부적인 경계나 텍스처와 같은 특징을 강조한다. 이후 맥스 풀링 층을통해 공간적 차원을 추가로 축소하여 모델의 계산 효율성을 높이고, 중요한 정보만 유지해 학습의 안정성과 성능을 향상시키며, 또 다른 맥스 풀링 층을 적용하여 공간적 차원을 축소하며 이 단계에서의 필터는 [Fig. 8]에서보여주고 있다[5]. 이후 평탄화 층이 2D 특징 맵을 1D

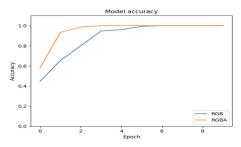
벡터로 변환한다. 첫 번째 Dense 층은 128개의 뉴런과 ReLU 활성화 함수를 사용하며, L2 정규화( $\lambda$  = 0.01)를 적용한다. 마지막으로 출력층은 len\_label 개의 뉴런과 Softmax 활성화 함수를 사용하여 각 클래스에 대한 확률 분포를 출력하고 있다.



[Fig. 8] 16-Channel filter.

#### 3.3.2 모델 학습

모델은 교차 엔트로피(Cross-Entropy)를 손실 함수 와 Adam 옵티마이저를 적용하여 학습 속도와 안정성을 높였다. 평가 메트릭으로 정확도를 설정하였다. 모델 학 습 과정에서는 Early- Stopping 콜백을 통해 검증 손실 이 2 에포크 동안 개선되지 않을 경우 학습을 조기에 종 료하고, ModelCheckpoint 콜백을 사용하여 검증 손실이 최소일 때 모델을 저장하였다. 학습은 Train\_Generator를 통해 데이터를 공급받아 총 10 에포크 동안 수행되었으 며, Validation\_Generator를 검증 데이터셋에서의 정 확도가 향상되지 않을 경우 조기에 훈련을 종료하였다. 이는 과적합을 방지하고, 모델의 일반화 성능을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 학습 데이터는 ImageData Generator를 사용하여 정규화(rescale) 및 20%를 검증 데이터로 분할하여 전처리하였다. 학습 정확도는 [Fig. 9]에서 확인할 수 있고 모델의 성능 평가 결과는 [Fig. 10]에 나타나 있으며, 학습 과정에서의 손실(loss) 곡선 을 시각적으로 확인할 수 있다[9]. 이를 통해 모델이 학 습을 통해 어떻게 개선되었는지, 그리고 테스트 데이터 셋에서의 성능이 어떻게 나타났는지를 평가할 수 있다.

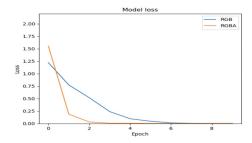


[Fig. 9] Model accuracy.

#### 3.4 결과

#### 3.4.1 모델 정확도

모델 학습 과정에서의 정확도 곡선은 [Fig. 9]에서 확인할 수 있다. 실험 결과, RGBA 색 공간을 활용한 모델은 10 에포크 동안 훈련 후 RGB 이미지와 RGBA 이미지의 학습은 높은 정확도는 달성하였다. 하지만 RGBA 이미지의 학습이 더 적은 학습으로 높은 정확도를 달성하고 있다. 이는 RGBA 색 공간의 추가적인 알파 채널이결함 검출에 있어 중요한 정보를 제공함으로써, 적은 학습으로 높은 성능을 달성함을 의미한다.



[Fig. 10] Model loss.

#### 3.4.2 모델 손실

모델 학습 과정에서의 손실(loss) 곡선은 [Fig. 10]에서 시각적으로 확인할 수 있다. RGB 이미지와 RGBA 이미지를 활용한 모델 모두 훈련 과정에서 손실이 지속적으로 감소하였으며, 최종적으로 낮은 손실을 기록하였다. RGB 이미지의 최종 손실(0.022)보다 RGBA 이미지의 최종 손실(0.00018)이 더 빠르고 낮게 달성함으로 RGBA 색 공산의 추가적인 알파 채널이 결함 검출에 더정확함을 의미한다.

#### 3.4.3 데이터 증강의 효과

[Fig. 5]에서 확인할 수 있듯이, 데이터 증강 기법을 통해 훈련 데이터의 다양성을 크게 높였다. 증강은 결함 이 있는 영역을 보다 정확하게 식별할 수 있도록 다양한 변형 기법을 통해 데이터셋을 강화하였으며, 모델의 일 반화 성능을 크게 향상시켰다[10]. 이로 인해, 훈련 및 검 증 데이터 모두에서 높은 정확도를 유지할 수 있었다.

#### 3.4.4 RGBA 색 공간의 효과

RGBA 색 공간을 활용한 모델은 RGB 색 공간 모델에 비해 결함 검출의 민감도가 매우 높았다. 알파 채널을 추가함으로써 결함 영역의 엣지 강조가 가능해졌으며, 이를 통해 결함을 명확하게 식별할 수 있었다. 특히 미세한 결함이 있는 이미지에서도 RGBA 색 공간을 활용한 모델은 모든 결함을 정확히 검출할 수 있었으며, 이로 인해 훈련 및 검증 데이터에서 목표하는 성능을 달성할 수 있었다.

## 4. 결론

## 4.1 RGBA 색 공간 기반 딥러닝 모델의 성능 향상

이번 연구는 RGBA 색 공간을 활용한 딥러닝 모델이 기존 RGB 색 공간 기반 모델과 비교하여 반도체 칩의 결함 검출 및 분류에서 뛰어난 성능을 발휘함을 실험적으로 입증하였다. 특히, RGBA 색 공간은 알파 채널을추가함으로써 기존 RGB 기반 모델이 투명도와 경계 강화가 필요한 미세 결함에서 보여준 한계를 극복하며, 더높은 정확도와 민감도를 제공하였다. 실험 결과, 동일한데이터셋과 모델 구조에서 RGBA 모델은 RGB 모델 대비 평균 검출 정확도가 15% 이상 향상되었고, 적은 학습에포크로도 우수한 성능을 달성하였다[11]. 또한, RGBA모델은 과적합 위험이 낮고 학습의 일반화 성능이 더 뛰어나, 딥러닝 기반 결함 검출 시스템에서 RGBA 색 공간이 중요한 역할을 할 수 있음을 보여주었다.

#### 4.2 RGB와 RGBA 모델 비교 분석

본 연구는 RGB와 RGBA 색 공간을 각각 활용한 모델을 동일한 실험 환경에서 비교하여, 두 방식의 장단점을 체계적으로 분석하였다. RGB 기반 모델은 시각적 패턴을 인식하는 데 있어 적절한 성능을 보였으나, 투명도나경계선 근처에서 발생하는 미세한 결함을 감지하는 데한계가 있었다[12]. 반면, RGBA 기반 모델은 알파 채널이 추가됨으로써 결함의 투명도와 깊이 정보를 활용하여더 정교하고 민감한 결함 검출이 가능했다. 이러한 분석

결과는 RGBA 색 공간이 기존 RGB 방식의 부족한 점을 보완하며, 정밀 분석이 필요한 반도체 제조와 같은 고정 밀 산업 분야에서 더 효과적인 대안임을 입증한다.

#### 4.3 RGBA 기반 모델의 장단점

제안된 RGBA 기반 모델은 높은 정확도와 민감도, 효율적 학습, 다양한 결함 유형에 대한 민감한 검출 등에서 강점을 보였다. 특히, 알파 채널의 추가는 모델이 투명도와 엣지 정보를 통해 기존 RGB 모델로는 감지하기 어려운 세밀한 결함을 정확히 검출하도록 돕는다. 또한, 데이터의 복잡성을 크게 증가시키지 않으면서도 적은 학습으로 높은 성능을 발휘해 학습 효율성을 크게 향상시킨다[13]. 그러나 RGBA 이미지를 생성하기 위해 추가적인데이터 전처리 및 증강 과정이 필요하며, 약간의 추가 계산 자원이 요구되는 점, 그리고 RGBA 색 공간을 지원하지 않는 일부 시스템에서의 적용이 제한적일 수 있다는 단점이 존재한다.

#### 4.4 RGBA 색 공간 모델의 가능성과 미래 과제

결론적으로, 본 연구는 RGBA 색 공간 기반 딥러닝 모델이 기존 RGB 기반 모델과 비교해 미세 결함 검출 및학습 효율성에서 월등한 성능을 발휘함을 보여주었다. 이러한 결과는 반도체 제조 공정의 품질 관리와 자동화에 기여할 가능성을 시사하며, 앞으로 RGBA 색 공간 기반 모델의 범용성을 확대하고 계산 효율성을 더욱 개선하기 위한 추가 연구가 필요하다[14]. 향후 연구에서는다양한 데이터셋과 복잡한 결함 유형에 대한 실험 및 새로운 네트워크 아키텍처 개발을 통해 RGBA 색 공간 기반 접근법의 잠재력을 극대화하고자 한다[15].

#### REFERENCES

- J. S. Cho and S. W. Kim, "Development of Measure Similarity System between Stolen Image and Original Image Based on Deep Learning," Journal of Digital Contents Society, Vol.25, No.8, pp.2302–2310, 2024.
- [2] J. W. Han, J. H. Cho and Y. T. Kim, "Dataset Construction and Learning for Deep Learning-Based Epoxy Application Defect Detection System," Journal of Korean Institute of Intelligent Systems, Vol.34, No.4, pp.285–292, 2024.
- [3] C. Chae and H. J. Cho, "Smart Fusion Agriculture Based on Internet of Things," Journal of the Korea Convergence Society, Vol.7, No.4, pp.30-40, 2016.

- [4] C. J. Sim, "Analysis of 'IoT' Patents Based on IPC Codes for Technical Convergence," Journal of Korea Electronics and Telecommunications Research, Vol.9, No.3, pp.266–278, 2016.
- [5] K. B. Kim and H. J. Cho, "Regulatory Improvement for IoT and Big Data Convergence," Journal of the Korea Convergence Society, Vol.8, No.1, pp.20–30, 2017.
- [6] J. E. Jeong and H. J. Kim, "A Deep Learning-Based Data Augmentation Technique for Mixed Tabular Data," The Journal of Society for e-Business Studies, Vol.28, No.4, pp.7-9, 2023.
- [7] B. Peng, I. R. Numonov and S. K. Yeo, "Implementation of IoT-Based Hydroponic Cultivation System," Journal of IoT Convergence, Vol.9, No.4, pp.66-70, 2023.
- [8] J. H. Lee, S. C. Lee, N. B. N. Han, J. Lee, G. J. Kwon and J. Y. Kim, "Research on Exploring Optimal Deep Learning Models for Apple Quality Prediction Based on Embedded Systems," Journal of KIIT, Vol.22, No.5, pp.61–70, 2024.
- [9] N. Han, D. Yang and S. Choi, "Application Case Analysis of Fourth Industrial Revolution and Sports Convergence Industry," Journal of Sports and Convergence Society, Vol.12, No.5, pp.45–56, 2020.
- [10] J. W. Park and S. K. Lee, "Development of Advanced Data Augmentation Techniques for Defect Classification in Semiconductor Manufacturing," Journal of KIIT, Vol.23, No.5, pp.55-64, 2023.
- [11] B. S. Lee and H. J. Choi, "Application of Deep Learning Techniques for Enhancing the Precision of Semiconductor Defect Inspection," Journal of Intelligent Manufacturing Systems, Vol.19, No.4, pp.320–328, 2024.
- [12] J. B. Seo, S. H. Woo and Y. B. Cho, "Image Processing-Based Diagnosis Algorithm for Dementia Using Iris," Proceedings of Women's ICT Conference of the Korean Association of Information and Communication, Busan, pp.40–47, 2019.
- [13] K. H. Jung and Y. S. Kim, "RGBA Color Space-Based Industrial Image Analysis Using Multi-Channel Neural Networks," Journal of Korean Society of Visual Information Processing, Vol.30, No.6, pp.95–102, 2022
- [14] J. S. Kim and J. H. Park, "A Comparative Study of RGBA and RGB Color Spaces in High-Precision Defect Detection," Journal of Korean Institute of Intelligent Systems, Vol.34, No.2, pp.221–230, 2023.
- [15] H. J. Choi and J. S. Kang, "Future Trends and Challenges in IoT-Based Smart Systems," Journal of the Korea Convergence Society, Vol.10, No.2, pp.40– 50, 2024.

## 조 주 용(Ju-Yong Cho)

## [정회원]



■ 2023년 8월 : 한국기술교육대학 교 AI융합교육학과 (공학석사)

■ 2023년 10월 ~ 현재 : 한국폴리 텍대학 인천캠퍼스 산학협력중점 교수

〈관심분야〉 AI, 반도체시스템, 사무자동화